

レーザー描画装置

メーカー：ハイデルベルグ

型番：DWL 66FS

【仕様】

- 最小描画幅 1 μ m
- 最小アドレスグリッド(位置分解能) 0.1 μ m
- 両面アライメント
- アライメント精度 0.25 μ m(おもて面)
3 μ m(裏面)
- 最大描画エリア □200mm



本装置の概要・用途

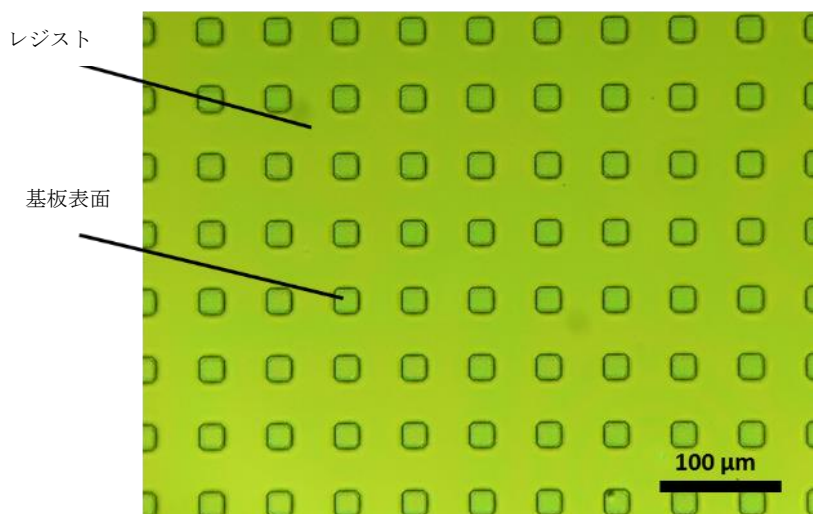
研究開発用のレーザー描画装置です。フォトレジストを塗布した基板などの試料に、微細なレーザービームを高精度で照射して微細パターンを描画します。

描画するパターンはCAD(AutoCADやDraftSight等)の図面として装置に取込みます。CADデータとおりのデザインをレーザー照射により、フォトレジスト上へ描画します。

本装置で描画したフォトレジスト上のパターンは、エッチングや薄膜のリフトオフなどのプロセスに利用することができます。

またアライメントカメラシステム搭載により、試料取付位置の補正が可能です。なお、カメラは試料の上下に搭載されており、試料の両面いずれのマークからでも位置合わせして描画できます。

描画例



本装置で描いたドット状デザインの光学顕微鏡写真
(□20 μ m、55 μ m ピッチ)